

МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА ПОДЛОЖКУ

МВУ ТМ МАГНА 11, 12

Назначение: Нанесение пленок металлов и диэлектриков на подложки (пластины) методом магнетронного распыления.



Особенности:

- Тип и количество МРУ в установке:
Магна 11, постоянного тока – 2 шт.;
Магна 12, постоянного тока – 1 шт., ВЧ – 1 шт.;
- Групповая обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка): $\varnothing 100$ мм – 4 шт., $\varnothing 150$ мм – 2 шт.; (двусторонняя обработка): 60x48 – 6 шт.;
- Периодический поворот подложкодержателя на 90° ;
- Количество ионных источников – 1 шт.;
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки;
- Мощность потребления не более 4,5 кВт.

